

日 光 協 ニ ュ ー ス

No.301/302

2025 年 9 月/10 月

日本光学工業協会

本年 9 月、10 月の合併号としてお届け致します。

令和 7 年度 ISO/TC 172/SC 1/WG 1, WG 2 合同委員会開催

7 月 3 日(木)から 10 月 6 日(月)にかけて、令和 7 年度 ISO/TC 172 (光学及びフォトリソグラフィ) /SC 1/WG 1, WG 2 国内委員会が対面、もしくは個別 Web 会議にて開催されました。

令和 7 年度の ISO/TC 172/SC 1/WG 1 及び WG 2 国内委員会委員は次の方々です。

<WG1>

氏名	勤務先・関係委員会・組織等
平井 真一郎	キャノン株式会社
金山谷 信道	株式会社ニコン
山崎 和秀	オリンパスメディカルシステムズ株式会社
曾和 誠司	コニカミノルタ株式会社
石井 幹彦	株式会社ニコン
室谷 裕志	東海大学
半田 宏治	パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社
岩堀 恒一郎	株式会社ニコン
木村 友紀	キャノン株式会社

<WG2>

氏名	勤務先・関係委員会・組織等
佐藤 陽輔	オリンパスメディカルシステムズ株式会社
金山谷 信道	株式会社ニコン
西村 威志	キャノン株式会社
内山 翔	コニカミノルタ株式会社

戸枝 純也	株式会社トプコン
向井 香織	株式会社ニコン
上窪 淳二	HOYA 株式会社
畑下 千恵子	株式会社オプトル

議題

国際会議関連の審議項目の確認。

1. WG 1 の審議項目

- 1.1. ISO/WD 9358 “Optics and Photonics – Stray light”
- 1.2. ISO/FDIS 11421.2 “Optics and photonics — Uncertainty of optical transfer function (OTF) measurement”
- 1.3. 1.3. Systematic Review of ISO 15529:2010 “Optics and photonics — Optical transfer function — Principles of measurement of modulation transfer function (MTF) of sampled imaging systems”

2. SC 1/WG 1 + SC 3/WG 1 Joint Meeting の審議項目

- 2.1. ISO/WD 15368-2 “Optics and photonics — Measurement of reflectance and transmittance — Part 2: Internal transmittance”

3. WG 1 + WG 2 Joint Meeting の審議項目

- 3.1. ISO/DIS 10110-5 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 5: Surface form tolerances”
- 3.2. ISO/DIS 14999-4 “Optics and photonics — Measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of surface form and wavefront deformation tolerances specified in ISO 10110”

4. WG 2 の審議項目

- 4.1. ISO/PWI 10110-1 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and system — Part 1: General”
- 4.2. ISO/PWI 10110-9 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 9: Surface treatment and coating”
- 4.3. ISO 10110-14 “Optics and photonics - Preparation of drawings for optical elements and systems - Part 14: Wavefront deformation tolerance”
- 4.4. Status of ISO 10110-17 and review of ISO/TC 172/SC 9 activities
- 4.5. ISO/PWI 10110-18 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae”
- 4.6. Systematic Review of ISO 10110-19 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 19: General

description of surfaces and components”

- 4.7. Comments on ISO/PWI 12123 “Optics and Photonics — Specification of raw optical glass” (Standard of SC 3/WG 1)
- 4.8. GPS resolution 18/2024
- 4.9. Review of joint web meeting with SC 3/WG 2

5. WG 3 の審議項目

- 5.1. Systematic Review of ISO 9022-2:2015 “Optics and Photonics — Environmental test methods — Part 2: Cold, heat and humidity”
- 5.2. Systematic Review of ISO 9022-6:2015 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 6: Dust”
- 5.3. Systematic Review of ISO 9022-7:2015 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 7: Resistance to drip or rain”
- 5.4. Systematic Review of ISO 9022-8:2015 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 8: High internal pressure, low internal pressure, immersion”
- 5.5. Systematic Review of ISO 9022-11:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 11: Mould growth”
- 5.6. Systematic Review of ISO 9022-12:2015 “Optics and Photonics — Environmental test methods — Part 12: Contamination”
- 5.7. Systematic Review of ISO 9022-14:2015 “Optics and Photonics — Environmental test methods — Part 14: Dew, hoarfrost, ice”
- 5.8. Systematic Review of ISO 9022-17:2015 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 17: Combined contamination, solar radiation”
- 5.9. Systematic Review of ISO 9022-20:2015 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 20: Humid atmosphere containing sulfur dioxide or hydrogen sulfide”

尚、国際会議は 10 月に開催しており、次号にて報告予定です。

JIS 原案作成委員会

JIS 原案作成公募制度 2025 区分 B に応募し、第 2 回 JIS 原案作成委員会を開催いたしました。以下、議事内容より抜粋です。

対象規格

JIS B7156：ライフルスコープ仕様

JIS B7263-3：望遠鏡試験方法－第 3 部：ライフルスコープ

開催日時：2025 年 9 月 17 日(水) 13:30～16:30

場 所：機械振興会館 B3 階 B3-9 会議室、Web 会議併用

出席委員：平井委員長、渋谷委員、伊藤委員、加藤委員、渡辺委員、酒井委員、成川委員、
田中委員、坂本委員、荒井委員

関係者：青山様（経済産業省）、佐久間様（経済産業省）、飯島様、永壽様

事務局：上田

- ・平井委員長より、JIS B7263-3 第 5 項より説明し審議した。JIS B 7156 は第 1 回コメントより更新した原案を審議した。
- ・永壽様より JIS B7156 解説を説明し審議した。制定時の趣旨、図の修正等の指摘があり、反映していく。JIS B7263-3 解説の審議も行った。
- ・第 2 回委員会の審議コメントを原案と解説に反映し、11 月に様式調整を進める予定。

対象規格

JIS B0090-18：光学素子及び光学システム用の製図手法－第 18 部：応力複屈折、
泡及び異物、均一性並びに脈理

開催日時：2025 年 9 月 25 日(木) 13:30～16:30

場 所：機械振興会館 B3 階 B3-7 会議室、Web 会議併用

出席委員：室谷委員長、渋谷委員、伊藤委員、西村委員、戸枝委員、上窪委員、
佐藤委員、内山委員、金山谷委員

関係者：青山様（経済産業省）、唐井様（経済産業省）

事務局：上田

主な審議確認事項

- ・佐藤委員より JIS B0090-18 第 7 項より説明し、事前に受領したコメントを審議した。
- ・第 2 回委員会の審議コメントを原案に反映し、解説を準備し、11 月に第 3 回委員会を予定する。

令和 7 年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について(御依頼)

雇均総発 0926 第 1 号令和 7 年 9 月 26 日

厚生労働省雇用環境・均等局総務課長より、当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

厚生労働行政の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)による改正後の労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年 5 日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする改正事項が施行されている中、大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

このような状況を改善するため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会では、「しわ寄せ」防止に向けた施策を総合的かつ継続的に推進するために令和元年 6 月に策定した「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)に基づき、「しわ寄せ」防止に向けた取組を推進しております。

総合対策では、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会が連携し、「しわ寄せ」防止に向けた各種施策を講じることとしており、特に、11 月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置付け、同月に実施される「過重労働解消キャンペーン」と連携を図りながら、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行うこととしています。

つきましては、貴職におかれましても、本取組の趣旨を御理解いただき、同封のポスターの掲示やリーフレットの配布、広報誌への掲載等により、傘下企業等への周知に御協力いただきますようお願いいたします。

なお、リーフレットは、以下に掲載しておりますので、御活用ください。

○ 「しわ寄せ」防止特設サイト

<https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/>

過労死等防止に関するポスター等の送付について

令和 7 年 9 月

厚生労働省労働基準局総務課過労死等防止対策推進室より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

平素より、厚生労働行政の運営につきましては、格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

過労死等防止対策推進法では、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるため、毎年 11 月を「過労死等防止啓発月間」と定めております。

また、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和 6 年 8 月 2 日閣議決定）においても、国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等に対する理解を深めるとともに、それを防止することの重要性について自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう、国と労使団体は相互に協力・連携しつつ、広く継続的に広報・啓発活動に取り組んでいくことが必要とされております。

今般、当該月間にあたり、ポスター、パンフレット及びリーフレットを作成しましたので、送付いたします。

各種業務御多忙のところとは存じますが、法及び大綱の趣旨を御理解いただき、「過労死等防止啓発月間」を中心に、ポスターの掲示等による周知に御協力いただきたくお願い申し上げます。

パンフレット等の追加送付の要望等がありましたら、下記の担当までご連絡ください。

(参考)厚生労働省ホームページの掲載場所

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働基準>過労死等防止対策
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053725.html>

関係団体情報

一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内

『図解による顕微鏡入門』技術講座

光学顕微鏡は最も古典的な光学機器でありながら、今や最先端のバイオ研究、半導体・微細加工などのモノ作りの現場において、肉眼で見えない像を捉えるという重要な役割を果たしています。

現代の顕微鏡は、各種の用途に応じた専用の構成とシステム化が進められ多彩な機能の製品が提供されていますが、今までに顕微鏡の基礎原理からシステム構成・各種の観察方法・デジタルイメージングなどの全体像を系統的に学べる機会はほとんどありませんでした。

本講座では、顕微鏡ユーザーおよびシステム導入を検討中などの方などを対象に、基礎原理を理解した上で機種選定やシステム構築が自在にできるよう、実務経験豊富な講師陣の講義によって顕微鏡のしくみと関連技術を易しく習得して頂くことを目的としておりますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。

開催日：2026年2月17日（火） 10:00～16:55

会 場：ハイブリッド形式（対面+オンライン）

- ・機会振興会館 別館4階（日本オプトメカトロニクス協会 研修室）
- ・オンライン（Web会議ツールは、Microsoft Teams です。）

プログラム及び講師：

10:00～11:00 「光学顕微鏡の基礎知識」

阿部 勝行 氏 ((株)エビデント 開発部門 光学開発 先進技術担当部長)

11:10～12:10 「照明系の特徴と役割」

阿部 勝行 氏 ((株)エビデント 開発部門 光学開発 先進技術担当部長)

12:20～13:05 「色々な顕微鏡のタイプ」

林 一馬 氏 ((株)エビデント 開発部門 光学開発 光学システム開発)

14:05～14:55 「顕微鏡のデジタルイメージング」

野口 晴 氏 ((株)ニコン ヘルスケア事業部 技術統括部 設計開発部)

15:05～16:00 「顕微鏡の観察方法」

大内 由美子 氏 ((株)ニコン 光学本部 第一設計部 部長)

16:10～16:55 「新しい顕微システムと超解像顕微鏡の技術」

大西 秀太朗 氏 ((株)ニコン ヘルスケア事業部 ソリューション企画部)

『ナノ領域の光学』応用編

本講座では、2021 年度まで開催していた「ナノ領域の光学入門」の参加者の要望に応じて今年度から新しく企画したものである。「ナノ領域の光学入門」の講義内容を踏まえて、ナノ光学で生み出される特異な光学現象や光学機能がどのような技術に応用できるかを解説する。講座は、5つのチュートリアルから構成されており、それぞれ 1) フォトニック結晶技術の光エレクトロニクスデバイスへの応用、2) 表面プラズモンのエネルギー変換技術への応用、3) ナノスケール分光イメージング技術、4) メタサーフェス・メタレンズ、5) メタマテリアルによる光吸収デバイスと分光計測応用について、その分野で活躍中の先生方に最先端の話題を解りやすく解説するようお願いしている。

講座では、2021 年度まで開催した「ナノ領域の光学入門」の内容を繰り返して講義しないので、「ナノ領域の光学入門」の内容を習得済みの若手技術者や、本年度開講する「ナノ領域の光学」基礎編を受講される方、これからナノ光学技術の応用を目指す光学設計者にとって最適かつ効率良く最新応用技術を学ぶ事が出来る講座になっている。

開催日：2026 年 1 月 27 日（火） 10:00~16:40

会 場：オンライン（Web 会議ツールは、 Microsoft Terms です。）

プログラム及び講師：

10:00~11:00 「フォトニック結晶の光エレクトロニクスデバイス応用」

岩本 敏 氏（東京大学先端科学技術研究センター 教授）

11:10~12:10 「メタマテリアルの光吸収体ならびに分光応用」

田中 拓男 氏（(国) 理化学研究所 メタフォトンクス研究チーム チームディレクター）

13:20~14:20 「金属ナノ構造を用いたナノスケール分光イメージング」

矢野 隆章 氏（徳島大学 ポスト LED フォトニクス研究所 教授）

14:30~15:30 「メタサーフェス・メタレンズ応用」

岩見 健太郎 氏（東京農工大学 大学院工学研究院 先端機械システム部門 准教授）

15:40~16:40 「プラズモニク・メタマテリアルの光電子デバイスの展開」

久保 若奈 氏（東京農工大学 大学院工学研究院 先端電気電子部門 教授）

『ナノ領域の光学』基礎編

本講座では、発展著しい「ナノ領域の光学」を、基礎から分かりやすく解説する。講座は5つのチュートリアルから構成されており、どの項目もその分野の最先端で活躍中の先生方に、屈折率分散や群屈折率の概念から、ナノ光学に特有な現象の原理の理解と、それらの制御をもとにした様々な応用まで系統的な解説をお願いしている。

微細構造での光の振る舞いを理解するにはスカラー場理論だけでは限界があり、必要に応じて偏光含めたベクトル場を扱う必要があるが、物理的な意味を見失わない範囲でできるだけ平易に解説することを目指している。またシミュレーション技術として不可欠な FDTD 法(有限差分時間領域法)についても、具体的な応用を念頭に置いた解説をする。

ナノ領域の光学を基礎から応用まで学びたい若手技術者、新しい光学の応用を目指す光学設計者にとって最適かつコンパクトな講座である。

開催日：2026 年 1 月 26 日（月） 10:00~16:40

会 場：オンライン（Web 会議ツールは、 Microsoft Terms です。）

プログラム及び講師:

10:00~11:00 「ナノ領域の光学—なぜ面白いのか? 何ができるのか?—」

岩本 敏 氏（東京大学先端科学技術研究センター 教授）

11:10~12:10 「近接場光学の基礎」

矢野 隆章 氏（徳島大学 ポスト LED フォトニクス研究所 教授）

13:20~14:20 「メタマテリアル」

田中 拓男 氏（理化学研究所 メタフォトニクス研究チームチームディレクター）

14:30~15:40 「メタサーフェス」

高原 淳一 氏（大阪大学 大学院工学研究科 教授）

15:40~16:40 「金属ナノ粒子の共鳴光散乱」

田丸 博晴 氏（東京大学大学院理学系研究科 特任教授）

『デジタルカラー画像の解析・評価』技術講座

高速ネットワークの環境の整備スマホの普及など画像システムのデジタル化が急激に進んでいる。銀塩写真フィルム、光学カメラが瞬く間にデジタルカメラに凌駕されたことは記憶に新しい。カメラ機能を持つスマホの普及により画像観測時の視環境も極めて多様となった。一方、CG と実画像の融合、AI による新しい画像の再現表示も映画、ゲーム、医用画像を中心に広く普及するようになった。このような時代、階調再現性、鮮鋭性、色再現、ノイズ特性ばかりでなく FPD の大型化、4K, 8K、立体テレビ等の開発に伴う質感、臨場感、偏角特性、動画像特性なども画像設計評価において考慮することが重要となった。従って、視覚の諸特性は勿論、画像鑑賞時の疲労なども含めて総合的に画像評価を考えることが要請されている。本講座では、このような新しい時代の画像の評価、解析について基礎から応用まで講師の長年の研究に基づいてパワーポイントによるテキストを用いて判りやすく講述する。これからこの分野に従事される方はもちろん、すでに実務を担当されており、さらに理解を深めたい方にもぜひ受講されることをお勧めいたします。

開催日：2026 年 2 月 5 日(木)～6 日(金) 10:00～17:00

会 場：今年度はハイブリッド（対面+オンライン）での開催となります。

対面：機械振興会館別館 4 階 研修室

オンライン：Microsoft Teams 利用

※対面希望者が少ない場合はオンラインに切り替える場合がございます。

講 師：三宅 洋一 氏（千葉大学名誉教授,東京工芸大学理事）

プログラム：

1. 総論
2. 視覚の特性
3. 色再現
4. 分光画像処理
5. 動画像と疲労の評価
6. 色彩と医用画像
7. まとめ

『現代干渉計測入門』技術講座

干渉計測は古くて新しい技術です。光波長が物差しの最小目盛りだった時代から現代のナノ計測の時代になっても常に進化を続けています。その活力の源は物理(光学, 干渉計)と数理(信号処理, コンピュータ)の有機的結合のもたらす多様な可能性にあると思われます。このような視点から本講座では, 近年飛躍的な進歩をとげた現代干渉計測技術について物理と数理の両面から複眼的にその原理と実際について学ぶことを目的としています。

干渉計測は原理の面でも応用の面でも分野横断的な複合技術であるところにその特色があります。したがって, 本講座を受講することにより, 光学設計者や光学加工技術者の方は自身で設計または製作した光学素子がどのように検査され, 組み上げた光学系の波面収差がどのように計測されるかを学ぶことができます。また光エレクトロニクス技術者や画像技術者の方は, 現代干渉計測技術を知ることにより, 光技術とエレクトロニクスのインテグレーションや画像処理や信号処理技術の応用のための実践的な方法論を学ぶことができます。光学, 通信理論, 画像・信号処理など専門分野を横断した広い視点から現代干渉計測技術の本質を学びたい方には最適な技術講座ですので、多くの方のご参加をお待ちしております。

開催日：2026 年 1 月 16 日 (金) 10:00～16:30

会 場：オンライン (Microsoft Teams 利用) での開催となります。

講 師：武田 光夫 氏 (宇都宮大学オプティクス教育研究センター特任教授)

プログラム:

1. 干渉計測のための予備知識
2. 干渉縞解析の基礎
3. 位相アンラッピング
4. 白色干渉計測・スペクトル干渉計測
(Optical Coherence Tomography の理解に向けて)

『光学系基礎理論』技術講座

本技術講座は、これから光学系を取り扱ったり、設計したりする仕事につこうとする初心者のために、近軸理論を中心にした光学系の基礎理論を、体系的に理解してもらうことを目的として開催するものです。

とくに、収差論を学ぼうと考えておられる方々は、近軸理論についての理解が前段階として必要ですので、この機会に是非本技術講座を受講されるようおすすめします。収差論の理解が一段と深まると考えます。

開催日：2026年1月14日、21日、28日、2月4日、10:00～17:00

会 場：ハイブリッド形式（対面+オンライン）

- ・機械振興会館 別館 4 階 研修室（東京都港区芝公園 3-5-22）
- ・オンライン（Microsoft Teams）

講 師：荒木 敬介 氏（宇都宮大学 客員教授 工博）

プログラム：

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. 序論 | 3.2 理想結像と収差 |
| 1.1 はじめに | 3.3 球面収差 |
| 1.2 光源と光学系の役割 | 3.4 コマ収差 |
| 1.3 幾何学とその基本法則 | 3.5 正弦条件 |
| 1.4 平らな境界面での光線の屈折 | 3.6 非点収差と像面湾曲 |
| 1.5 平らな境界面での光線の反射 | 3.7 歪曲 |
| 1.6 光学用の材料について | 3.8 色収差 |
| | 3.9 偏心による収差 |
| 2. 結像光学系の基礎 (1) 近軸理論 | |
| 2.1 結像とはどういうことか | 4. 結像光学系の機能 |
| 2.2 距離の定義と符号の規約 | 4.1 像の大きさ |
| 2.3 球面での光線の屈折と近軸結像 | 4.2 像の明るさ |
| 2.4 横倍率と Helmholtz-Lagrange 不変量 | 4.3 画像情報の伝達特性 |
| 2.5 非球面と反射面の取り扱い | 4.4 分光透過率と色再現特性 |
| 2.6 光学系の構造と近軸光線の追跡 | |
| 2.7 薄肉レンズと近軸結像 | 5. レーザー用光学系の基礎 |
| 2.8 実際の光学系と近軸結像 | 5.1 レーザービームの形態 |
| 2.9 光学系の焦点距離と主点位置の計算 | 5.2 光学系によるビーム形態の変化 |
| 2.10 afocal 系とその特性. | |
| 3. 結像光学系の基礎 (2) 収差とその性質 | 6. レーザー用光学系の機能とその応用 |
| 3.1 光学系と絞り | 6.1 スポットの形成 |
| | 6.2 画像のフーリエ変換 |

2025 年 7 月生産・出荷累計統計

	生産		受入	出荷			月末在庫
	数量	金額 (百万円)		販売		その他	
				数量	金額 (百万円)	数量	
デジタルカメラ	246,601 (1.22)	14,813 (1.12)	380,236 (1.13)	316,965 (1.31)	28,934 (1.19)	380,213 (1.18)	217,723 (0.75)
カメラ	7,728 (0.92)	11,199 (1.00)	7,228 (1.05)	5,842 (0.81)	9,145 (0.87)	6,969 (0.96)	12,644 (0.95)
交換レンズ	162,206 (1.06)	11,501 (1.11)	378,103 (0.92)	354,594 (1.04)	23,413 (1.17)	222,698 (0.99)	1,049,591 (0.96)
光学・精密測定機	22,890 (1.36)	5,550 (1.10)	—	26,406 (0.97)	5,815 (1.04)	—	105,693 (1.02)
光分析機器	13,054 (1.02)	31,542 (1.12)	—	12,265 (0.97)	30,582 (1.07)	—	24,187 (1.02)
測 量 機	2,721 (1.02)	707 (0.97)	—	5,849 (0.74)	1,184 (0.92)	—	8,605 (0.85)
合 計	—	75,312 (1.10)	—	—	99,073 (1.10)	—	—

() 内は、前年比

2025 年 8 月生産・出荷累計統計

	生産		受入	出荷			月末在庫
	数量	金額 (百万円)		販売		その他	
				数量	金額 (百万円)	数量	
デジタルカメラ	171,878 (1.08)	10,525 (1.22)	261,150 (0.95)	152,603 (0.78)	12,152 (0.79)	261,641 (0.97)	236,439 (0.91)
カメラ	4,999 (0.92)	7,138 (1.05)	5,153 (0.99)	4,050 (0.77)	6,563 (0.89)	4,860 (0.95)	13,886 (1.02)
交換レンズ	125,540 (0.97)	9,094 (1.11)	296,631 (0.82)	250,491 (0.79)	17,140 (0.91)	172,845 (0.85)	1,048,429 (0.99)
光学・精密測定機	16,062 (1.20)	5,279 (1.22)	—	21,835 (0.94)	5,777 (1.15)	—	100,358 (1.01)
光分析機器	11,368 (0.92)	25,273 (1.02)	—	11,785 (0.96)	24,643 (1.00)	—	23,618 (1.01)
測 量 機	1,778 (1.03)	522 (1.12)	—	5,134 (0.84)	1,210 (1.06)	—	9,073 (0.88)
合 計	—	57,831 (1.09)	—	—	67,485 (0.93)	—	—

() 内は、前年比

注) 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

- (イ) 他企業から購入したもの(輸入を含む)
- (ロ) 同一企業内の他工場から受入れたもの
- (ハ) 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの
- (ニ) 返品(戻入れ)されたもの

令和 7 年 10 月 31 日発行

日本光学工業協会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 204 号室

電話・ファックス: 03-3431-7073

<https://www.e-joia.jp> e-mail: joia.office@e-joia.jp

発行人 牛 田 一 雄

編集 上田 壮一 (事務局)